







Приложение №2 к учебному плану

Шифр направления:  
 Направление:  
 Образовательная программа:  
 Уровень: Магистр  
 Нормативный срок освоения ООП: 2 года  
 Форма обучения: Очная  
 Стандарт ВО: СУОС

**11.04.04**  
 Электроника и нанoeлектроника  
**Физическая электроника**

Условия освоения ООП: **Полный срок**  
 Технология освоения ООП: **Традиционная**  
 Фактический срок освоения ООП: **2 года**

Одна зачетная единица: 36ч.

N п/п	Индекс	Наименование дисциплин	Объем работы в часах и виды учебной нагрузки											Номер модуля/дисциплины	
			Всего часов	В т.ч. контактная работа	Аудиторная				Контактная			Самостоят. работа	В т.ч. контактная работа по самост. работе		В т.ч. контактная работа по промежуточной аттестации
					Всего часов	Лекции	Прак. занятия	Лаб. занятия	Контактная работа по лекции	Контактная работа по прак.	Контактная работа по лаб. занятиям				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Общая трудоемкость основной образовательной программы</b>	<b>4320</b>	<b>1054.70</b>	<b>936</b>	<b>450</b>	<b>90</b>	<b>396</b>	<b>414</b>	<b>54</b>	<b>288</b>	<b>3384</b>	<b>113.40</b>	<b>24.30</b>	
	<b>Б1</b>	<b>Дисциплины (модули)</b>	<b>2160</b>	<b>893.70</b>	<b>936</b>	<b>450</b>	<b>90</b>	<b>396</b>	<b>414.00</b>	<b>54.00</b>	<b>288.00</b>	<b>1224</b>	<b>113.40</b>	<b>24.30</b>	
1	<b>Б1.Б</b>	<b>Обязательная часть</b>	<b>1296</b>	<b>468.05</b>					<b>234.00</b>	<b>54.00</b>	<b>108.00</b>		<b>59.40</b>	<b>12.65</b>	
2	<b>М.1.1</b>	<b>История и методология науки и техники</b>	<b>108</b>	<b>0.25</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>72</b>		<b>0.25</b>	<b>1142546</b>
3	1.1.1	История и методология науки и техники	108	0.25	36	36	0	0				72		0.25	1142547
4	<b>М.1.2</b>	<b>Проектная деятельность</b>	<b>432</b>	<b>4.66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>432</b>		<b>4.66</b>	<b>1158474</b>
5	1.2.1	Проектный практикум 1	216	2.33	0	0	0	0				216		2.33	1158465
6	1.2.2	Проектный практикум 2	216	2.33	0	0	0	0				216		2.33	1158462
7	<b>М.1.3</b>	<b>Управление интеллектуальной собственностью</b>	<b>108</b>	<b>41.65</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18.00</b>	<b>18.00</b>		<b>72</b>	<b>5.40</b>	<b>0.25</b>	<b>1142549</b>
8	1.3.1	Управление интеллектуальной собственностью	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	1142548
9	<b>М.1.4</b>	<b>Методы математического моделирования</b>	<b>108</b>	<b>83.05</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>	<b>36</b>	<b>10.80</b>	<b>0.25</b>	<b>1142559</b>
10	1.4.1	Методы математического моделирования	108	83.05	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	0.25	
11	<b>М.1.5</b>	<b>Актуальные проблемы современной электроники больших мощностей</b>	<b>108</b>	<b>83.05</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.00</b>			<b>36</b>	<b>10.80</b>	<b>0.25</b>	<b>1159333</b>
12	1.5.1	Актуальные проблемы современной электроники больших мощностей	108	83.05	72	72	0	0	72.00			36	10.80	0.25	
13	<b>М.1.6</b>	<b>Плазмохимические процессы для создания и диагностики материалов</b>	<b>432</b>	<b>255.39</b>	<b>216</b>	<b>108</b>	<b>36</b>	<b>72</b>	<b>108.00</b>	<b>36.00</b>	<b>72.00</b>	<b>216</b>	<b>32.40</b>	<b>6.99</b>	<b>1159334</b>
14	1.6.1	Диагностика вещества и его поверхности	144	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	72	10.80	2.33	
15	1.6.2	Физика низкотемпературной плазмы	144	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	72	10.80	2.33	
16	1.6.3	Физические основы технологий микро- и нанoeлектроники	144	85.13	72	36	36	0	36.00	36.00		72	10.80	2.33	
17	<b>Б1.В</b>	<b>Формируемая участниками образовательных отношений</b>	<b>864</b>	<b>425.65</b>					<b>180.00</b>		<b>180.00</b>		<b>54.00</b>	<b>11.65</b>	
18	<b>М.1.7</b>	<b>Электрическая изоляция и разряд в вакууме</b>	<b>108</b>	<b>85.13</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>36.00</b>		<b>36.00</b>	<b>36</b>	<b>10.80</b>	<b>2.33</b>	<b>1142562</b>
19	1.7.1	Электрическая изоляция и разряд в вакууме	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	

20	М.1.8	Плазменно-пучковые технологии модификации материалов	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	1142567
21	1.8.1	Плазменно-пучковые технологии модификации материалов	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
22	М.1.9	Спектроскопия атомов, молекул и твердых тел	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	1159335
23	1.9.1	Спектроскопия атомов, молекул и твердых тел	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
24	М.1.10	Воздействие излучения на вещество	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	1142570
25	1.10.1	Воздействие излучения на вещество	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
26	М.1.11	Измерение СВЧ параметров материалов	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	1159336
27	1.11.1	Измерение СВЧ параметров материалов	108	85.13	72	36	0	36	36.00		36.00	36	10.80	2.33	
28	Б1.В.ВВ	По выбору студента	324		144	0	36	108				180			
29	М.1.12	Культура подготовки научной публикации	108	41.65	36	0	36	0		36.00		72	5.40	0.25	1158250
30	1.12.1	Культура подготовки научной публикации	108	41.65	36	0	36	0		36.00		72	5.40	0.25	
31	М.1.13	Академическое письмо на русском и английском языках	108	41.65	36	0	36	0		36.00		72	5.40	0.25	1147725
32	1.13.1	Академическое письмо на русском и английском языках	108	41.65	36	0	36	0		36.00		72	5.40	0.25	
33	М.1.14	Электрофизика и электрофизические установки	216	124.45	108	0	0	108			108.00	108	16.20	0.25	1159337
34	1.14.1	Электрофизика и электрофизические установки	216	124.45	108	0	0	108			108.00	108	16.20	0.25	
35	М.1.15	Спецпрактикум	216	124.45	108	0	0	108			108.00	108	16.20	0.25	1159338
36	1.15.1	Спецпрактикум	216	124.45	108	0	0	108			108.00	108	16.20	0.25	
	Б2	Практика	1944	128.00	0	0	0	0				1944			
37	Б2.Б	Обязательная часть	1944	128.00											
38	М.2.1	Практика	1944	128.00	0	0	0	0				1944			1159339
39	2.1.1	Производственная практика, научно-исследовательская работа	864	16.00	0	0	0	0				864			
40	2.1.2	Производственная практика, преддипломная	864	16.00	0	0	0	0				864			
41	2.1.3	Учебная практика, технологическая	216	96.00	0	0	0	0				216			
	Б3	Государственная итоговая аттестация	216	33.00	0	0	0	0				216			
42	Б3.Б	Обязательная часть	216	33.00											
43	М.3.1	Государственная итоговая аттестация	216	33.00	0	0	0	0				216			1142705
44	3.1.1	Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы	216	33.00	0	0	0	0				216			
	Б4	Факультативы	216	50.50	44	12	32	0	11.52	32.40		172	6.58		
45	Б4.В	Формируемая участниками образовательных отношений	216	50.50					11.52	32.40			6.58		
46	М.4.1	Адаптационный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья	216	50.50	44	12	32	0	11.52	32.40		172	6.58		1156238
47	4.1.1	Основы личностного роста	108	25.25	22	6	16	0	5.76	16.20		86	3.29		
48	4.1.2	Развитие ресурсов организма	108	25.25	22	6	16	0	5.76	16.20		86	3.29		